

薄膜実験装置・コンポーネント 2018 Autumn

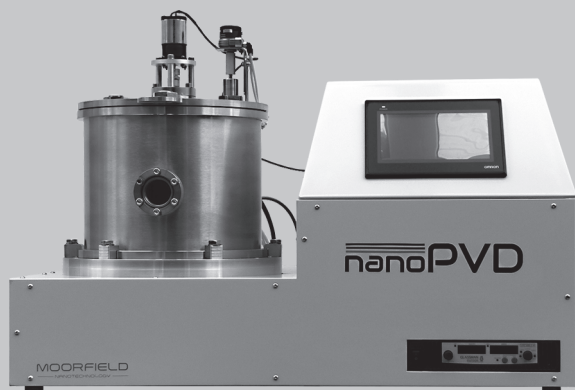
テルモセラ・ジャパン株式会社

nanoPVD-S10A ハイパフォーマンス 卓上型マグネトロンスパッタリング装置

nanoPVD

特徴

到達圧力 5×10^{-5} Pa (*4Paまで最速30分!)



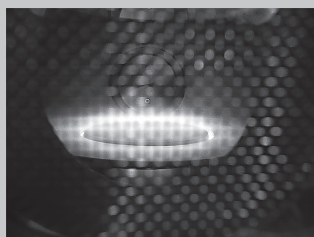
基板サイズ: Φ 2inch, Φ 4inch
 2inchマグネトロンカソード: 最大3基
 TMP+RP (標準) DryPumpオプション
 DC850W/RF150W (自動マッチング付)
 MFC流量制御x3系統 (Ar, N2, O2)
 基板回転・上下昇降・基板ヒーター
 水晶振動子膜厚モニタ
 USB接続 PCデータロギング
 最大1000layer, 50膜厚レシビ登録

外形寸法: 804(W) x 504(D) x 614(H)mm

【多機能 ハイパフォーマンス！ 研究開発用に最適な省スペース卓上型スパッタリング装置】



3x Magnetron Cathodes



Front View Port

Process Execution: Process 23			Plots
Layer:	3	MFC1 flow (sccm):	5.0
Layer time, total (s):	144	MFC2 flow (sccm):	0.0
Deposition time (s):	64	MFC3 flow (sccm):	1.5
RF PSU %:	20	Hi-res pressure (mbar):	5.0E-3
RF source:	2		
DC PSU %:	35	Heater temp. (°C):	150
DC source:	3	Rotation speed (%):	50

System status: Deposition stage

Buttons: Back, Next Layer, Hold Layer, Process Start, Process Stop

7inch Touch Screen

NEW

【Mini-BENCH】超高温小型卓上実験炉Max2200°C

小型卓上サイズ 低価格 基礎実験に最適な卓上カーボン炉



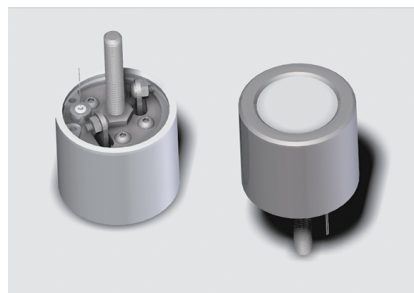
- カーボン炉: Max2200°C
- メタル炉 : Max2000°C
- Φ 1", Φ 2"ウエハー用面状ヒーター
- Φ 50ルツボ加熱用円筒状ヒーター



【BHシリーズ】基板加熱ヒーター Max1600°C

超高温薄膜実験用 基板加熱ヒーター (*大学・研究機関限定品)

- 有効加熱範囲: Φ 1", Φ 2", Φ 4"
- 最高使用温度: 1000°C (カンタル), 1600°C (SiCコート・グラファイト)



Thermocera

テルモセラ・ジャパン株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 新橋町ビル別館第一 2F Tel: 03-6214-3033 Fax: 03-6214-3035

Web site : www.thermocera.com

E-mail : sales@thermocera.com